# JP2551191B2:FINGERPRINT PATTERN MATCHING SYSTEM

Country:

JP Japan

Kind:

**B2** Published Registered Patent Specification

Inventor(s):

Atsushi YAMASHIROYA

Applicant(s):

NIPPON ELECTRIC CO

Issued/Filed Dates:

Nov. 6, 1996 / March 9, 1990

Application Number:

JP1990000059179

IPC Class:

G06T 7/00;

ECLA Code:

none

Priority Number(s):

March 9, 1990 JP1990000059179

Family:

Patent	Issued	Filed	Title		
JP3260778A2	Nov. 20, 1991	March 9, 1990	FINGERPRINT PATTERN MATCHING SYSTEM		
JP2551191B2	Nov. 6, 1996	March 9, 1990	SHIMONPATAANSHOGOHOSHIKI		
2 family members shown above					

Other Abstract Info:

JAPABS 160068P000007

Foreign References:

No patents reference this one

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

# 第2551191号

(45)発行日 平成8年(1996)11月6日

(24) 登録日 平成8年(1996) 8月22日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G06T 7/00

G06F 15/62

460

請求項の数1(全 9 頁)

(21)出願番号

特願平2-59179

(22)出顧日

平成2年(1990)3月9日

(65)公開番号

特開平3-260778

(43)公開日

平成3年(1991)11月20日

(73)特許権者 999999999

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

(72)発明者 山代屋 篤

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気

株式会社内

(74)代理人

弁理士 京本 直樹 (外2名)

審査官 千葉 輝久

# (54) 【発明の名称】 指紋パターン照合方式

1

#### (57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】鑑定されるべき探索指紋パターンとこれに 照合される少なくとも一つのあらかじめ登録されたファイル指紋パターンとをそれぞれのパターンの特徴点の情報によって比較照合する指紋パターン照合方式において、パターンの特徴点の位置を該特徴点が属する指紋の中心点を原点とする極座標により表示する手段と、指紋の中心点を原点として予め等間隔に定めた放射線および予め定めた幾つかの半径による同心円によりプロック分割した各セルに対して一対一で対応する記憶領域を作成10する手段、前記記憶領域のそれぞれに対応する前記セル内にある特徴点の情報を記憶する手段、一つの前記セル内に二つ以上の特徴点が含まれる場合に対応する前記記憶領域に前記セル中に含まれる特徴点の数を記憶する手段と、前記セルに対応する前記記憶領域を前記探索指紋 2

パターンおよび前記ファイル指紋パターンのそれぞれに 用意してそれぞれ同じ座標上にある前記セルに対応する 前記記憶領域の内容を演算回路によって各々比較演算を 行う手段と、前記比較演算の結果により前記探索指紋パ ターンおよび前記ファイル指紋パターンの指紋の照合結 果を判定する手段と、一回の命令で最小1前記セル分単 位で回転移動の座標変換を行う手段と、粗照合を行うた めに座標上隣り合う予め定めた数の前記セルに対応する 記憶領域を論理合成して一つの大きな拡大セルにして扱 う手段とを有することを特徴とする指紋パターン照合方 式。

# 【発明の詳細な説明】

〔産業上の利用分野〕

本発明は指紋パターン照合方式に関し、特に指紋読み取り装置および指紋照合処理装置における指紋パターン

3

照合方式に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来の指紋パターン照合方式は、探索指紋パターンおよびこれに比較するファイル指紋パターンについて、コード化された各パターンの特徴を、探索指紋パターンの特徴点番号およびファイル指紋パターンの特徴点番号のそれぞれに対して記憶している。そして各パターンの特徴を示すデータには、特徴点番号N,特徴点種別Q,特徴点の座標(X,Y),方向D,集密量Cおよびその特徴点を中心に4分割された各象限における最近傍にある他の特徴 10点番号MOからM3、その特徴点と各象限の最近傍の他の特徴点との間に介在する隆線数ROからR3等がある。

また、従来の指紋パターン照合方式の特徴として、 親、子及び孫特徴点の使用が挙げられる。すなわち、一つの基準となる特徴点を親特徴点として、この特徴点を 中心に4分割された各象限における親特徴点に対する最 近傍点を子特徴点とし、この子特徴点を中心に4分割された各象限おける子特徴点に対する最近傍点を孫特徴点 としている。そして、これらの親、子、孫特徴点の集合 を一つの照合単位として考え、これらの照合単位により、探索指紋パターンと、ファイル指紋パターンとを順 次比較していく。従って、探索指紋パターンとファイル 指紋パターンとのそれぞれに、特徴点がn個ある場合 に、これらが親特徴点となるので、親特徴点の照合は、 n³回繰り返さなければならず、子および孫特徴点の照合 を含めると大変な繰り返し計算となる。

## [発明が解決しようとする課題]

上述した従来の指紋パターン照合方式は、各特徴点の データ中にその特徴点の座標情報を持っており、これに より探索指紋パターンの特徴点の一つに対するファイル 指紋パターンの特徴点のすべてをサーチしなければなら ないとともに、親、子、孫のそれぞれの特徴点を照合す るために、サーチ回数が非常に大きくなるという問題点 を有している。

さらに、親、子、孫の特徴点を用いる従来の指紋パターン照合方式は、親から子または孫の間に存在する隆線の数が親特徴点の情報となっており、子および孫の数と同じだけあるために情報量が多くなってしまうとともに、親から孫の間の隆線数が親から子および子から孫の間のそれぞれの隆線数から推測した値のために若干信頼 40性が落ちるという問題点を有している。

これらのことより、従来の指紋パターン照合方式は、 照合精度がかなり高いけれども、繰り返し処理を行うた めに、非常に多くの時間がかかってしまうという欠点を 有している。

### [課題を解決するための手段]

本発明の指紋パターン照合方式は、鑑定されるべき探索指紋パターンとこれに照合される少なくとも一つのあらかじめ登録されたファイル指紋パターンとをそれぞれのパターンの特徴点の情報によって比較照合する指紋パ 50

ターン照合方式において、パターンの特徴点の位置を該 特徴点が属する指紋の中心点を原点とする極座標により 表示する手段と、指紋の中心点を原点として予め等間隔 に定めた放射線および予め定めた幾つかの半径による同 心円によりプロック分割した各セルに対して一対一で対 応する記憶領域を作成する手段、前記記憶領域のそれぞ れに対応する前記セル内にある特徴点の情報を記憶する 手段、一つの前記セル内に二つ以上の特徴点が含まれる 場合に対応する前記記憶領域に前記セル中に含まれる特 徴点の数を記憶する手段と、前記セルに対応する前記記 憶領域を前記探索指紋パターンおよび前記ファイル指紋 パターンのそれぞれに用意してそれぞれ同じ座標上にあ る前記セルに対応する前記記憶領域の内容を演算回路に よって各々比較演算を行う手段と、前記比較演算の結果 により前記探索指紋パターンおよび前記ファイル指紋パ ターンの指紋の照合結果を判定する手段と、一回の命令 で最小1前記セル分単位で回転移動の座標変換を行う手 段と、粗照合を行うために座標上隣り合う予め定めた数 の前記セルに対応する記憶領域を論理合成して一つの大 きな拡大セルにして扱う手段とを有して構成されてい る。

#### (実施例)

20

次に本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第1図は指紋パターンの一例を示す指紋説明図である。また、第2図は第1図の指紋パターンに対する極座標の一例を示す座標構成図である。第2図の座標の原点(中心点)は、第1図の指紋パターンの中心点または中心点が不明の場合には中心軸上の適当な位置に対応させている。そして、第2図の座標で放射線 $\theta$ i  $-\theta$ i -1と同心円rj-rj-1とに囲まれている部分をセルとしている。なお、放射線の数,角度,同心円の直径,数などはパラメータとしてあらかじめ最初に決められている。

第3図は第2図のセルの番号の一例を示すセル番号説 明図である。セルの番号づけは、第3図に示すように、 中心部分から外側部分へ時計回りの順序に付けている。

第4図は第2図の極座標表示における特徴点座標の例を示す特徴点座標説明図である。また、第5図は第4図の特徴点と第3図のセルとの配置関係の一例を示す配置関係説明図である。第4図および第5図に示すように、特徴点A,B,Cは、第4図のように、極座標表示によってあらわされ、この特徴点A,B,Cが、第5図で、どのセルに含まれているかを調べている。すなわち、まず特徴点の中心からの距離を調べ、特徴点が半径rjとrj-1との間に含まれるときのjの値を求める。第5図に示す特徴点Aのjは2、特徴点Bのjは3、特徴点Cのjは2である。次に角度を調べ、特徴点が角度 $\theta$ kと $\theta$ k-1との間に含まれるときのkの値を求める。第5図に示す特徴点Aのkは2、特徴点Bのkは2、特徴点Cのkは1である。これらの二つの数j,kをすべての特徴点につい

10

30

6

て調査する。この結果、特徴点のすべてにjとkの値が 割り当てられ、これによって(j,k)によって対応づけ られるセルに特徴点の割り付けが可能となる。

第6図はj, kの値を割り付けた各テーブルの例を示す情報構成図である。第6図(a)はセル番号とj, kとの対応テーブル、第6図(b)は中心からの距離rとjとの対応テーブル、第6図(c)は角度 $\theta$ とkとの対応テーブルをそれぞれ示している。

そして、それぞれのセルの座標内にある特徴点の情報 をそのセルに対応する記憶領域の中に記憶させている。 これは一つの座標セルに対応している記憶領域であり、 記憶セルと呼ぶことにする。

第7図は一つのセルに対応する記憶セルの例を示す情報構成図である。第7図(a)は対応する座標上のセル内に特徴点が一つある場合の一例を示し、第7図(b)は二つ以上ある場合の一例を示しいる。第7図のEは2ビットを有し、上位ビットが特徴点の有無を示し、ある場合には「1」、無い場合には「0」であり、下位ビットが特徴点の数を示し、1個以下の場合には「0」、2個以上の場合には「1」である。そして、この下位ビットによって、以下の記憶セルの内容が変わり、「0」の場合には第7図(a)の形態となり、「1」の場合には第7図(b)の形態となる。

第8図は第7図のQおよびMの例を示す情報構成図である。第8図(a)に示すように、Qは2ビットで特徴点の種類を示している。一方、第7図(b)のCは特徴点の数を示し、4ビットで一つのセルに最大15個までの数を示すことができる。また、第9図は隆線の方向の求め方の一例を示す説明図である。第7図(a)のDは特徴点における隆線の方向で有り、第9図に示すように、中心点からの同心円の接線の時計回りの方向を基準として反時計回りの角度 $\theta$ (360度を256として示す)を表現している。

また、第7図(a)のVは降線の曲率を示し、方向Dに対して、左曲を+、右曲を-として、 $-7\sim7$ の数値で表現している。他方、第7図(a)のRは最も近い他の特徴点までの距離であり、 $0 \le R \le 511$ で表現している。さらに、第7図(a)のMは降線の数であり、最も近い他の特徴点との間に存在する降線数を2ピットで示すもので、その内容は、第8図(b)に示している。

第10図はセル番号と記憶領域の内容との関係の一例を示す情報構成図である。座標上のセルと記憶セルとの対応が、第10図により示されている。なお、特徴点が入ってないセルは、すべてのビットが0になっている。

第11図は探索側とファイル側との記憶セルの比較演算の一例を示す比較演算説明図である。また、第12図は第11図の一対のセルの比較演算の一例を詳しく表した比較演算説明図である。

次に、照合の方法について述べる。照合には第3段階 までがある。まず、第1段階では、Eのみ、つまり特徴 点の座標位置のみの比較を行う。第12図のEの演算回路では、そのセルの特徴点の有無と、もしある場合には、2個以上であるかどうかを比較している。Eの演算回路からの出力は、2ビットであり上位ビットで特徴の有無の比較結果を示している。なお、下位ビットは照合の第1段階では使用していない。この照合を各セルのEの演算回路で全セルについて行う。この結果から、セルが何箇所一致したか、また指紋の中心部で多く一致したのか、外部で多く一致したのかによって次の第2段階の照合を行うか、座標変換を行うかを決定する。座標変換の場合には回転移動等があるが、いづれの場合にも移動方向側にある隣接する記憶セルにデータを移すことにより座標変換を行う。そして、再び第1段階の照合を行う。

次に、第2段階の照合では、QまたはCの照合を行う。この照合では、第1段階の照合が一致したセルのみを比較の対象とする。第1段階の比較ではEの上位ビットのみを比較しているので、比較している二つのセル中の特徴点の数が双方とも一つ以上の場合には一致したとみなしている。特にどちらかのセル中の特徴点の数が二つ以上ある場合には、Eの演算出力の下位ビットが「1」となるので、この信号により第12図のNO.2の演算回路をCの演算を行う回路と決定する。

第13図は第12図の特徴点数の比較とその出力との一例を示した特徴点数演算説明図である。Cの演算は、特徴点の数の照合であり、その照合の出力結果を第13図に示している。そして、更にこの結果にどの位置でのセルの照合結果であるかの情報を加える。そして、指紋の中央部の照合結果を重く取るようにする。

また、Eの演算回路の下位ビットが「0」つまり双方 共にセル中に特徴点が一つ以下の場合には、第12図のN 0.2の演算回路は、特徴点の種類Qの照合となる。この 場合には、出力は1ビットで有り、一致している場合に は「1」、一致していない場合には「0」となる。

これらの演算を各セルについてそれぞれ行い、結果を 集計して、あらかじめ決められた基準値と比較して、基 準値に達しているか否かによって第3段階の比較を行う か、座標変換を行うかを決定する。座標変換は第1段階 の場合と同様で、座標変換が終了した後に、再び第1段 階の照合に戻る。

次に、第3段階の照合は探索側,ファイル側双方のセル中の特徴点の数が一つの場合であり、D(方向),V(曲率),R(最近傍特徴点迄の距離),M(隆線数)の比較照合を行う。

第14図は第12図の各パラメータおよびその比較演算結果の表現方法の一例を示す各パラメータ演算説明図である。4つのパラメータの照合をそれぞれ行うが、各パラメータには重み付けを可能とし、どのパラメータを重要と考えるかによって重みを設定する。各演算回路からの出力内容の一例を第14図に示している。この出力をそれぞれの重み付け回路に送り、その出力結果を集計してス

コアを算出する。

なお、最終段階から出された候補が二つ以上の場合が ある。この場合にはスコアにより順位付けを行う。

次に、指紋パターンの座標変換であるが、従来の指紋 パターン照合方式では座標変換の計算をしなければなら ないけれども、本実施例ではあらかじめ変換を行い易い ように記憶セルの接続を行っている。

第15図は座標変換回路の一例を示すブロック図である。また、第16図は第15図の一つの記憶セルに対する回路の一例を示すブロック説明図である。第16図に示すように、入力としてはデータファイルや入出力装置からのデータを取り込むためのデータ入力 (DIN)、座標変換によって隣のセルよりシフトされデータを取り込む為のシフト入力 (SIN)を持っている。出力はデータ出力 (DOUT)を有し、これはシフト出力も兼ねている。これらの入出力の制御は、データ入出力命令 (DC)、データシフト命令 (DSFT)によって行っている。

例えば、時計回りの回転移動が行われる場合には、まず第15図に示す双方向マルチプレクサの方向が決定され、時計回りの回転移動より、Aよりのデータを入力して、Bにデータ出力を行うように接続される。次にデータシフト命令によりセル番号nのセルへAからのデータが入力され、同時に記憶されていたデータをBに出力する。これらの操作により一セル分の回転移動が行われることとなる。

第17図は4個のセルを合成した一つの拡大セルの一例を示す座標構成図である。本実施例では、照合精度を粗くするために、第17図のような方法を取ることができる。すなわち、隣り合ったセルを4つ組み合わせて1つの拡大セルとして取扱う。このような方法をファイル側に行うことによって、あたかも粗いセル構造になったように処理される。

第18図は精度変更命令により拡大セルを形成する回路の一例を示すプロック図である。第18図の回路は、第11図の①の部分に組み込まれる。この回路では、精度変更命令により、スイッチ回路が合成回路側に切り換わる。合成回路では、4つの記憶セル中に特徴点が無い場合には、拡大セルの記憶には「0」を代入する。また、1個だけの場合には、存在していたセルの情報がそのまま拡大セルの情報となる。他方、2個以上の場合には、特徴 40点の数を記憶して残りのD, V, R, Mには「0」を入力する。

8

#### \* 〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明の指紋パターン照合方式は、指紋パターン上の放射線と同心円線とで囲まれる部分のセルに対応する記憶セルを用いることにより、周辺部分へ行く程セルが大きくなるので、指紋パターンの周辺部分に行く程目立ってくる歪みによる誤差を小さく出来るとともに、すべての記憶セルを並列に演算することが可能であるので、演算速度を著しく向上させることができるという効果を有している。

また、本発明の指紋パターン照合方式は、探索指紋パターン及びファイル指紋パターン共にその中心点が判明 している場合には、座標変換が極座標に有利な回転変換 のみでよいので、特に高速処理が可能であるという効果 を有している。

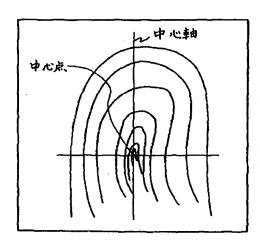
この結果、本発明は、指紋パターンがはっきりしている押捺系指紋の処理に対して、絶大な効果をあげることが期待できる。

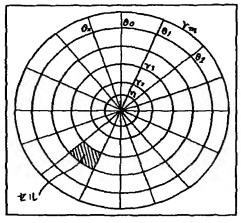
#### 【図面の簡単な説明】

第1図は指紋パターンの一例を示す指紋説明図、第2図 は第1図の指紋パターンに対する極座標の一例を示す座 標構成図、第3図は第2図のセルの番号の一例を示すセ ル番号説明図、第4図は第2図の極座標表示における特 徴点座標の例を示す特徴点座標説明図、第5図は第4図 の特徴点と第3図のセルとの配置関係の一例を示す配置 関係説明図、第6図はj,kの値を割り付けた各テープル の例を示す情報構成図、第7図は一つのセルに対応する 記憶セルの例を示す情報構成図、第8図は第7図のQお よびMの例を示す情報構成図、第9図は隆線の方向の求 め方の一例を示す説明図、第10図はセル番号と記憶領域 の内容との関係の一例を示す情報構成図、第11図は探索 側とファイル側との記憶セルの比較演算の一例を詳しく 表した比較演算説明図、第12図は第11図の一対のセルの 比較演算の一例を詳しく表わした比較演算説明図、第13 図は第12図の特徴点数の比較とその出力との一例を示し た特徴点数演算説明図、第14図は第12図の各パラメータ およびその比較演算結果の表現方法の一例を示す各パラ メータ演算説明図、第15図は座標変換回路の一例を示す ブロック図、第16図は第15図の一つの記憶セルに対する 回路の一例を示すプロック説明図、第17図は4個のセル を合成した一つの拡大セルの一例を示す座標構成図、第 18図は精度変更命令により拡大セルを形成する回路の一 例を示すプロック図である。

【第1図】

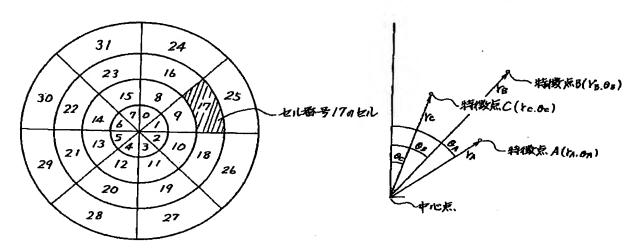
【第2図】





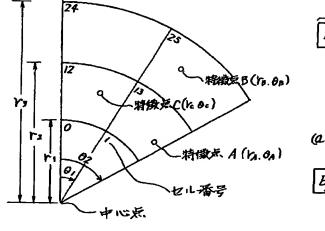
【第3図】

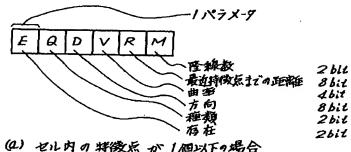
【第4図】



【第5図】

【第7図】





(a) セル内の特徴点が1個以下の場合



(b) セル内の特徴点が2個以上の場合

【第6図】

セル番号	rj-rj-19 すの恒	Ox-On111 Kol值
0	1	1
/	1	2
2	1	3
3	_ / _	4

(Q)ゼル番号とよ、Kとの対応テブル

正確	j
0~X	1
X~2X	2
2×~3×	3
3X~4X	4

171-71-1=XXT3

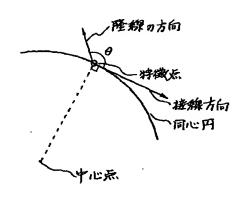
(b) 中じがの距離YY よYの対応デブル

角度 O	K	
0~7	1	
Y~2Y	2	
2Y~3Y	3	
3Y-4Y	4	

10x-0x-1=Y(\*) x+3

(c) 角度OY KYの対応デブル

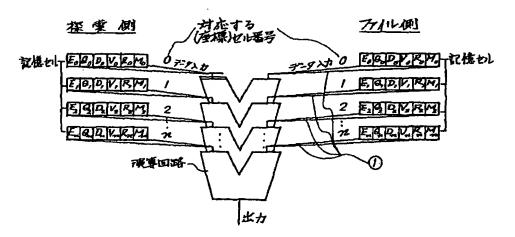
【第9図】



【第13図】

### 【第8図】

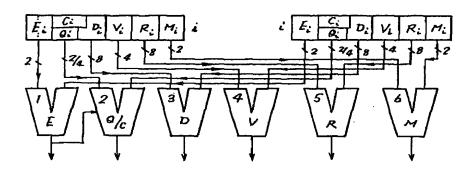
【第11図】



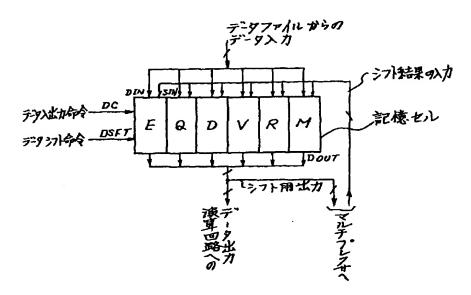
【第10図】

	E	4	C			0	
七小番号	E	Q		D	V	R	M
0	10	01	01	100111	0110	11000111	0100
1	00	00	00	000000	0000	00000000	0000
2	11	00	11	000000	0000	00000000	0000
3	10	10	10	001111	0111	11001111	0111
特徴点を含んでいないセル -特徴点を2つ以上含んでいるセル - 記憶領域 - 記憶セル							

【第12図】



【第16図】



# 【第14図】

D:方向 {裸察侧特徵点方向 Dt(\*) {7水似则 " Df(\*)

|Dt-Ds| な 360%4単 |位で表現する。 V:曲率 {探索侧 特徵点,a曲率 Vt(-7≤ Vt≤7) {7MU侧 / Vf(-7≦Vj≤7)

1Q-b1を 0~15の範囲で 表現する。

R: 最近傍特徵点距離

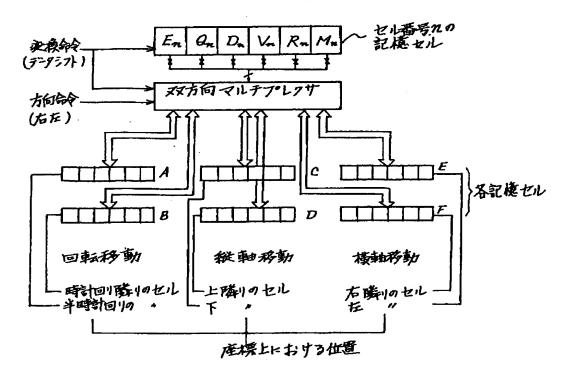
M: 隆線数

{探察側特徴点距離Rt(O≦Rt≦512) プァイル側 ク Rf(O6Rf≦512)

|Rt-R|| を 0~5/20 範囲で 表現する。 【探察側特徴点隆樂教 M ファルル側 1 M

Mt	Ms	<b>出力</b>
MI	MI	7
Mz	MZ	5
MI	M2	4
M2	MI	4
M4	ALL	3
ALL	M4	3
Mz	Mz	2
M3	Mz	2
MI	M3	1
M3	MI	/

【第15図】



【第17図】

【第18図】

